

# －SEAJ装置技術ロードマップ専門委員会－ 2008年度 ウェーハプロセスWG 活動報告

## 【活動目的】

2009年度の装置技術ロードマップ報告書改訂へ向けての準備作業として、デバイスニーズ検討状況を把握・共有し、プロセス/装置のニーズと技術動向を調査・理解する。

## 【活動概要】

### ●JEITA STRJ WGへの特別参加とレビュー

STRJのFEP-WG(WG3)、配線WG(WG4)に特別委員として参加し、デバイスサイドの問題意識・協議状況を把握。当WGでレビューし情報共有する。

### ●SEAJロードマップWG間の技術交流

リソグラフィWGの講演会に参加し、ダブルパターニングの要求と課題を把握。WG内メンバーから会社紹介、技術紹介を行い、技術交流を深める。

### ●有識者ヒアリング

ウェーハプロセス分野の有識者を招き、最新技術動向をヒアリング調査する。

## 【ヒアリング調査 実施テーマ一覧】

開催日	題目	講演者
10月30日	除害装置、除害技術の現状と将来	渋谷和信様(太陽日酸)
10月30日	プラズマドーピング技術の現状と将来	伊藤裕之様(バリアンセミコンダクターイクイップメント)
11月20日	界面な電子化学(ウエットプロセス)に関する課題と最近の研究	青木秀充様(大阪大学)
11月20日	フロントエンドプロセスの現状と将来 -High-k/Metal Gateと洗浄プロセス-	杉田義博様(Selete)
11月20日	バックエンドプロセス洗浄技術	近藤誠一様(Selete)
1月20日	3×~2×nm Node ドライエッチングの技術動向と課題	林 久貴様(東芝)
2月20日	気化器の現状と将来動向	河野武志様(堀場エステック)
3月25日	省エネ専門委員会の活動紹介	曾田光一様(アルバック、省エネ委員長)
3月25日	環境情報専門委員会の活動紹介	近藤 宏様(日立ハイテクノロジーズ、環境情報副委員長)
3月25日	PFC対策専門委員会の活動内容とガイドラインについて	新田哲士様(大塚電子、SEAJ・PFC対策専門委員長)
3月25日	PFC削減対策に対する現状と今後の課題	関屋 章様(産業総合研究所)

## 【まとめと今後の課題】

- 装置技術ロードマップ改訂の準備期間として、上流(STRJ)の状況を把握しつつ、ウェーハプロセス技術動向の調査を実施し知識ベース固めを行なった。
- ヒアリング調査では、洗浄技術、周辺関連技術を中心に原理・原則から最新技術動向までをカバーし、理解を深めることができた。
- 今後の課題は、ゲートや接合に代表されるFEOL関連技術、および新型を含むメモリー関連技術のヒアリング調査を強化し、調査成果を生かして装置技術ロードマップ報告書の改訂作業を行なう予定である。